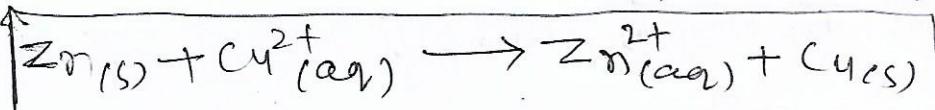


## विद्युतरसायन (Lecture-16)

→ विद्युतरसायनिक सेल को गैलवैनिक सेल (Galvanic cell) आ वोल्टीज सेल (Voltaic cell) भी कहते हैं।

जब  $Zn^{2+}$  तथा  $Cu^{2+}$  जलनों का सांकेतिक IM होता है तो इसका विद्युतीय विभव 1.1 V होता है।

→ जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से अधिकर बने गैलवैनी सेल को डेनिएल (Daniell cell) भी कहते हैं।



### रेडाक्स युग्म (Redox couple)

→ विद्युतरसायनिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रुप ताथे के इलेक्ट्रोड पर अवकलन होता है इसलिए इसे रेडाक्स युग्म कहते हैं।

### इलेक्ट्रोड विभव (Electrode potential)

→ इलेक्ट्रोड रुप विद्युत अपवर्धन के लिये विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं।

→ यह विसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोन त्याग करने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है।

यह नियन्त्रित हो पुकार का होता है।

(i) ऑक्सीफरण विभव (Oxidation potential) : → विसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोन त्याग करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीफरण विभव कहते हैं।

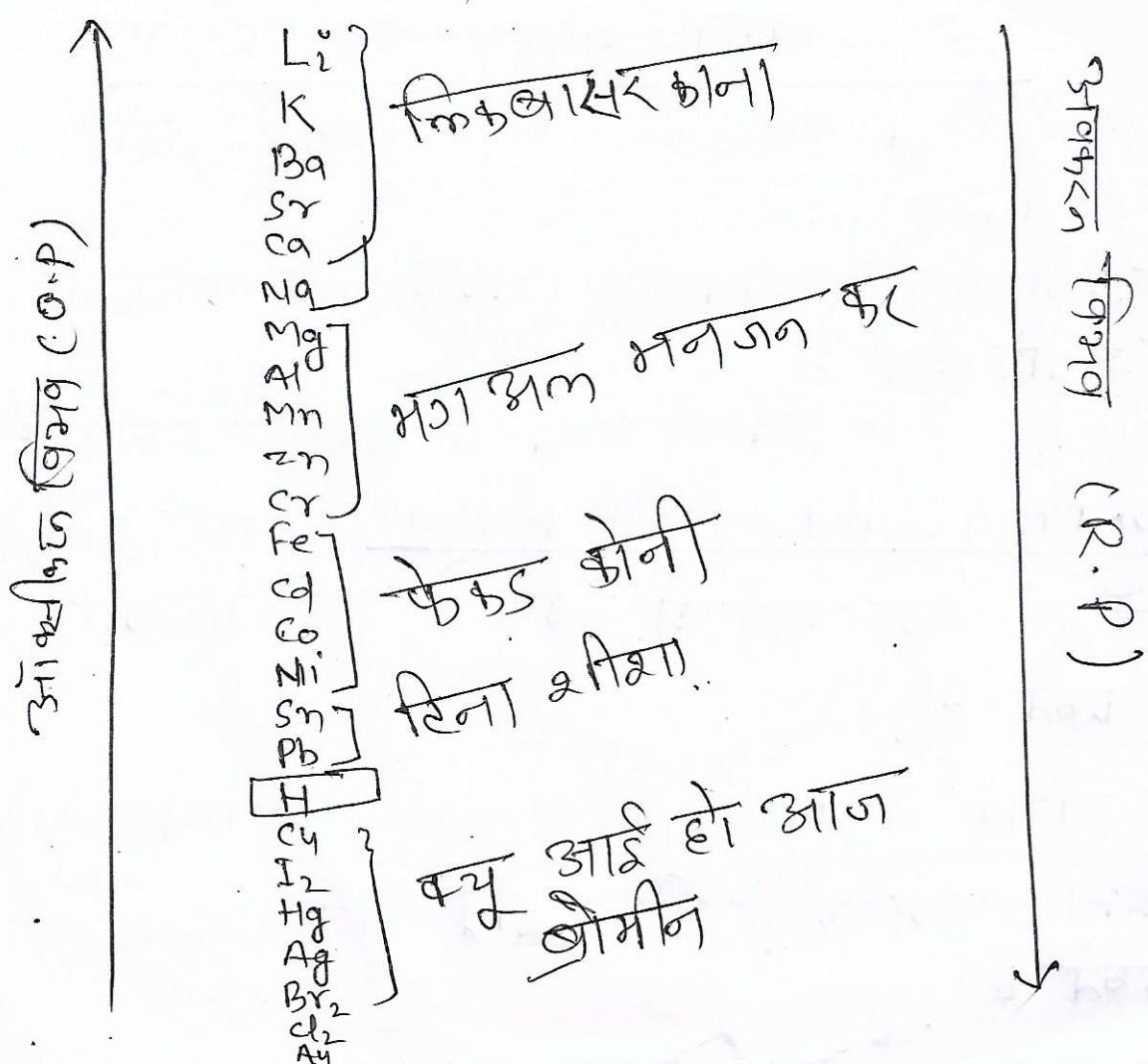
(ii) अवकरण विभव (Reduction potential) : → विसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण विभव कहते हैं।

~~V.N.S~~  
मानक इलेक्ट्रोड पिम्प (Standard electrode potential)

- विद्युत आग्ने के  $1\text{ M}$  (रुक्मील) सॉल्यूशन में  $298\text{ K}$  ताप रेवेल वाल पर इलेक्ट्रोड के किम्बु को मानक इलेक्ट्रोड पिम्प कहते हैं।
- इसे  $E^\circ$  कुरा सूचित किया जाता है।
- दृष्टिकोण के मानक इलेक्ट्रोड पिम्प को मान शुल्क होता है।

विद्युतरासाग्नि क्रमणी (Electrochemical series)

- वैसा क्रमणी जिसमें तब्दी को मानक इलेक्ट्रोड पिम्प के ओद्धर पर अवस्था किया जाता है उसे विद्युतरासाग्नि कहते हैं।



O.P  $\rightarrow$  oxidation potential  
 R.P  $\rightarrow$  Reduction potential

## विद्युतरसायन (Lecture-17)

विद्युतरसायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग

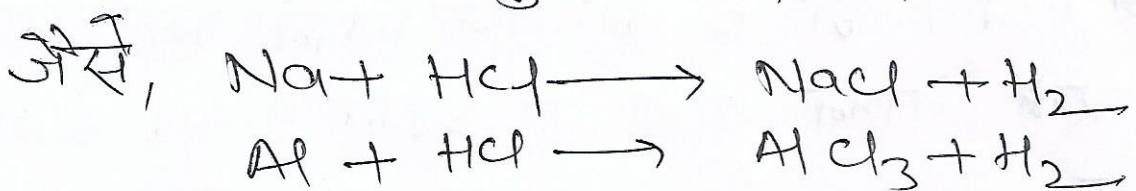
(Application of electrochemical series)

① ध्वातु की डिग्रीमत्रा की तुलना करने में → इसका

उपयोग ध्वातु कि डिग्रीमत्रा कि तुलना करने में दिए जाने के अन्तर्गत श्रेणी के उपर के तत्व अधिक डिग्रीमत्रा होता है जबकि नीचे के तत्व कम डिग्रीमत्रा होता है। परं निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक डिग्रीमत्रा ध्वातु है:

- (a) Al    (b) Mg    ~~(c) Na~~    (d) Zn

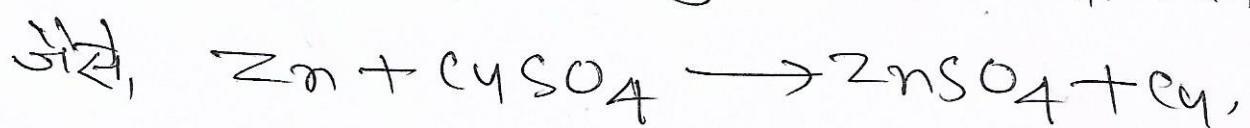
② इसके द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कौन ध्वातु अमीली विलापन से दाहशूजन गैस मुक्त करता है: श्रेणी में दाहशूजन के उपर के तत्व अमील से संगोग कर दाहशूजन गैस मुक्त करता है:



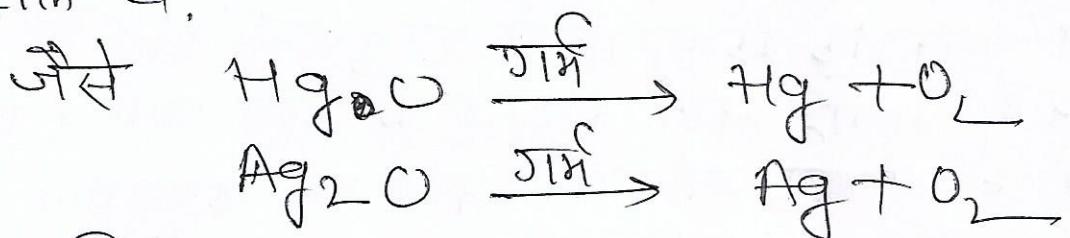
परं निम्नलिखित में कौन ध्वातु अमीली विलापन से दाहशूजन गैस मुक्त नहीं करता है:

- (a) Al    ~~(b) Cu~~    (c) Zn    (d) Na

③ इसके द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कौन सा ध्वातु लेपण के विलापन से दूसरे ध्वातु को विस्थापित करता है: → श्रेणी के उपर के तत्व नीचे वाले तत्व को उसके लेपण के विलापन में ध्वातु को विस्थापित करता है,



④ धातु के ऑक्साइड का अस्थिर स्थानिक  $\rightarrow$  श्रेणी  
की नीचे के तत्व का ऑक्साइड अस्थाई होता है।  
जिसके केवल गर्म करने से ऑक्सीजन जैसे मुक्त होता है।



योग्य नियमिति में इस धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ऑक्सीजन जैसे मुक्त होता है।

- (a)  $Na_2O$  (b)  $\cancel{Ag_2O}$  (c)  $K_2O$  (d)  $MgO$

⑤ आगन बनने की प्रवृत्ति के पुर्वानुमान में  $\rightarrow$

इस तत्व का E° का मान जितना कम होता है उसमें आगन बनने की प्रवृत्ति अधिक होता है अर्थात् श्रेणी के ऊपर के तत्व का E° कम होता है इसलिए इनकी बनने की प्रवृत्ति अधिक होता है।

- ⑥ इसके द्वारा पुर्वानुमान लगाया जाता है कि विचुतरसायनिक सेल में ~~खोला~~ खोले तथा खोले जाने होंगे  $\rightarrow$  इस तत्व का ऑक्सीजन विभव अधिक होता है वह खोलोड और जिसका अवकरण विभव अधिक होता है वह कैबोड होता है।

## वैद्युत रसायन (Lecture - 18)

→ वैद्युत अपघटन कि त्रिमा में जिस आजन का ऑक्सीडन्ट का विभव आधिक होता है वह ऐनोड पर और जिसका अवकलन विभव आधिक होता है वह कैथोड पर प्राप्त होता है।

Li

K

Ba

Sr

Ca

Na

Mg

Al

Mn

Zn

C<sub>8</sub>

Fe

Cd

Co

Ni

Sn

Pb

H

Cu

I<sub>2</sub>

Hg

Ag

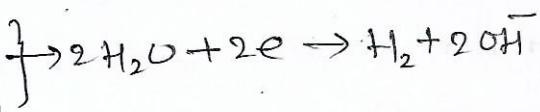
Br<sub>2</sub>

Cl<sub>2</sub>

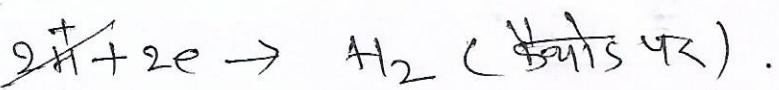
A<sub>4</sub>

F<sub>2</sub>

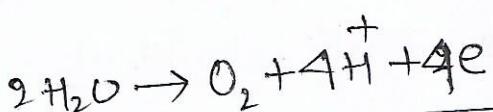
→ जिस तर्वर का ध्यानालन बढ़नीचे होता है वह कैथोड पर प्राप्त होता है जैसे K<sup>+</sup> तथा Na<sup>+</sup> साथ रहने पर कैथोड पर स्टेटिक्स प्राप्त होता है,



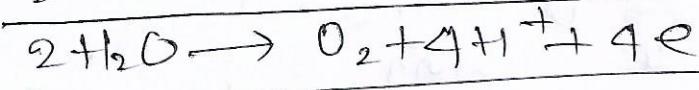
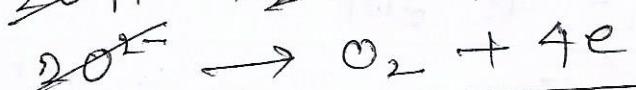
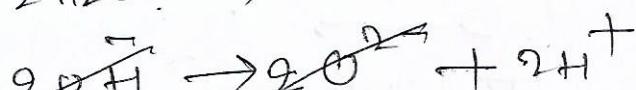
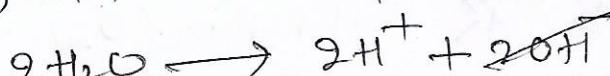
→ जल का अवकलन किए गए उत्पाद होता है



→ जल के अवकलन की त्रिमा में कैथोड पर डाइट्रोजन (H<sub>2</sub>) गैस प्राप्त होता है



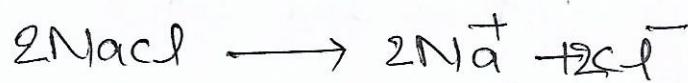
→ जल का ऑक्सीडन्ट का विभव उत्पाद होता है



→ जब एक से आधिक अणुओं उत्पादन होता है तो जो अणुओं  
 • उपर होता है वह इन्होंने पर याप्त होता है  
 जैसे  $I^- > Br^- > Cl^-$

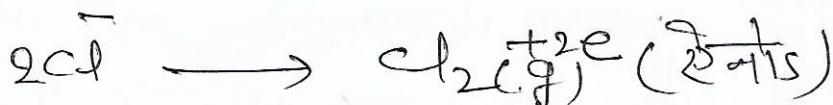
ज्ञान : → जल का ऑक्सीकरण रेखा अवकरण द्वारा होता है इसमें  
 द्वारा की तुलना करते हैं तो यह निम्न जलीय होता है

प्र० → जलीय NaCl का वैश्युत अपघटन



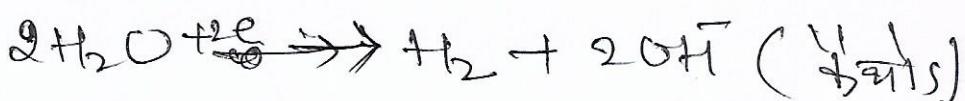
इन्होंने पर होने वाली अभिक्रिया :-

Cl<sup>-</sup> का ऑक्सीकरण विनियोग जल से कम है तिन्हीं सांख्यिकी में over potential के जरूर इन्होंने पर Cl<sub>2</sub> याप्त होता है।



केवांड पर होने वाली अभिक्रिया

→ जल का अवकरण विनियोग Na<sup>+</sup> से आधिक है इसमें जल का अवकरण होता है जिससे केवांड पर हाइड्रोजन याप्त होता है।



प्र० :- जलीय NaF का वैश्युत अपघटन

इन्होंने पर होने वाली अभिक्रिया

→ जल का ऑक्सीकरण विनियोग F<sup>-</sup> से आधिक है इसमें  
 केवांड पर ऑक्सीजन (O<sub>2</sub>) याप्त होता है।



प्र० :- केवांड पर होने वाली अभिक्रिया

→ जल का अवकरण विनियोग Na<sup>+</sup> से आधिक है इसमें  
 पर दायरोंपर याप्त होता है।